

主要半導体材料ガス等国内販売実績5年推移

(暦年：2006年～2010年)

一般社団法人 日本産業・医療ガス協会
特殊ガス企画委員会

番号	ガス名称	化学記号	2006年 (平成18年)		2007年 (平成19年)		2008年 (平成20年)		2009年 (平成21年)		2010年 (平成22年)	
			需要量	前年比	需要量	前年比	需要量	前年比	需要量	前年比	需要量	前年比
1	アルジン	Ash3	20,300	90%	20,200	100%	21,400	106%	15,600	73%	20,600	132%
2	ジボラン	B2H6	630	103%	630	100%	590	94%	430	73%	480	112%
3	三塩化ホウ素	BCl3	92,000	100%	92,000	100%	98,000	107%	101,100	103%	123,600	122%
4	四フッ化炭素	CF4	35,000	100%								
5	三フッ化メタン	CHF3	477,000	111%	494,000	104%	489,000	99%	357,500	73%	475,900	133%
6	六フッ化エタン	C2F6	67,600	131%	73,800	109%	85,200	115%	73,400	86%	86,100	117%
8	八フッ化シクロブタン	C4F8	453,000	89%	390,000	86%	343,300	88%	206,500	60%	247,900	120%
9	塩素	Cl2	25,000	109%	27,000	108%	29,000	107%	40,700	140%	43,700	107%
10	ゲルマン	GeH4	165,000	157%	185,000	112%	203,000	110%	172,900	85%	247,300	143%
11	臭化水素	HBr	100	100%	110	110%	120	109%	110	92%	110	100%
12	塩化水素	HCl	61,000	122%	72,200	118%	83,000	115%	74,900	90%	94,300	126%
13	アンモニア	NH3	240,000	109%								
14	三フッ化窒素	NF3	1,033,000	118%	1,132,000	110%	1,168,000	103%	979,400	84%	1,589,600	162%
15	一酸化二窒素	N2O	885,000	140%	1,168,000	132%	1,423,000	122%	1,232,600	87%	1,658,200	135%
16	ホスフィン	PH3	545,000	145%	610,000	112%	580,000	95%	490,700	85%	603,400	123%
17	モノシラン	SiH4	18,100	112%	18,400	102%	17,700	96%	11,700	66%	15,800	135%
18	ジシラン	Si2H6	319,000	110%	349,000	109%	407,000	117%	430,300	106%	547,500	127%
19	ジクロロシラン	SiH2Cl2	500	100%	500	100%	500	100%	550	110%	580	105%
20	四フッ化ケイ素	SiF4	125,500	105%	144,000	115%	155,000	108%	130,000	84%	160,000	123%
21	TEOS	(C2H5O)4Si	6,000	100%	6,000	100%	6,000	100%	6,000	100%	5,700	95%
22	六フッ化硫黄	SF6	205,000	144%	342,000	167%	378,000	111%	390,600	103%	424,500	109%
23	六フッ化タンゲスト	WF6	192,000	120%	197,000	103%	207,000	105%	186,300	90%	267,400	144%
24	有機金属		68,000	124%	78,000	115%	86,000	110%	90,000	105%	108,000	120%
25	その他	H2Se BF3 SiHCl3等	1,500	100%	1,500	100%	1,750	117%	1,610	92%	2,470	153%
年間需要金額(単位:億円)			476	110%	515	108%	552	117%	497	90%	603	

(注) *1:PBN用
*2:HCl
2007年より統計対象外
2007年より統計対象外